# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

2001-282126

(43) Date of publication of application : 12.10.2001

(51) Int. Cl.

9/00 G09F 1/13 G02F

1/1333 G02F

(21) Application number :

2000-

(71) Applicant : HITACHI TECHNO ENG CO LTD

097873

(22) Date of filing :

30.03.2000 (72) Inventor :

SAITO MASAYUKI

HACHIMAN SATOSHI

IMAIZUMI KIYOSHI

HIRAL AKIRA

## (54) SUBSTRATE ASSEMBLING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate assembling device which can align substrates with high accuracy within a vacuum chamber without damaging the substrates and can rapidly bond the substrates to each other. SOLUTION: A single table 8 or freely attachably and detachably fastening either one of the substrates 1A and 1B is arranged in the vacuum chamber 100 and there are arms extending in the respective directions of Xand Y at the flank sections of the table from each of the actuators 9 and 10 arranged outside the vacuum chamber. The table is adapted to be moved horizontally in the respective directions of X and Y and heta via the arms by the actuation of the respective actuators and further a pressurizing plate 27 for freely attachably and detachably fastening the other of the substrates is

arranged within the vacuum chamber. The substrate assembling device bonds both substrates by horizontally moving the table by means of the respective actuators to align the substrates to each other and moving the pressurizing plate toward the table.

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開香号 特開2001-282126 (P2001-282126A)

(43)公開日 平成13年10月12日(2001,10,12)

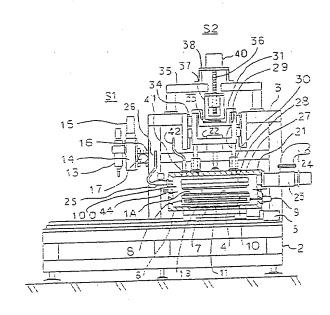
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FI 7-73(参考) C0085
GOSF	9/00	3 5 0 3 4 2	G09F 9/00 350Z 2H088 342Z 2H090
-	1/13 1/1333	1 0 1	G 0 2 F 1/13 1 0 1 5 G 4 3 5 1/1333 5 0 0
			審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	<u>.</u>	特額2000−97873( P2000−97873)	(71) 出願人 000233077 日立テクノエンジニアリング株式会社
(22)出類日		平成12年3月30日(2000.3.30)	東京都足立区中川四丁目13番17号 (72)発明者 斉藤 正行 茨城県電ヶ崎市向陽台 5 丁目 2 番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所
			内 (72)発明者 八幡 発 茨城県竜ヶ崎市向陽台 5 丁目 2 番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所
			内 (74)代理人 100059269 弁理士 秋本 正実 最終頁に続く

## (54) [発明の名称] 基板組立装置

## (57)【要約】 (修正有)

(課題)真空チャンバ内において基板を損傷することなっ く高精度に位置合わせでき、速やかに貼り合せることが 可能な基板組立装置を提供することである。

【解決手段】基板1A、1Bの何れか一方を脱着自在に固着させる単一のテーブル8が真空チャンバ100内に配置され、真空チャンバ外に配置した複数のアクチュエータ9,10の各々からテーブルの側面部にXYの各方向に作びたアームがあり、テーブルは各アクチュエータの動作によりアームを介してXYおよび6の各方向に水平移動するようになっており、さらに基板の他方を脱音自在に固着させる加圧板27が真空チャンバ内に配置され、前記テーブルを各アクチュエータにより水平移動させて基板同士の位置決めを行い、加圧板をテーブルの方向に移動させて両基板を貼り合せる基板組立設置。



## 【特許請求の範囲】

(請求項1)貼り合せるべき基板同士をそれぞれ上下に保持して対向させ、位置法めを行うと共に間隔を狭めて、いづれかの基板に設けた接着剤により真空中で両基板を貼り合せる基板組立装置において、

上面または下面に上記基板の何れか一方を脱着自在に固着させる単一のテーブルが真空チャンバ内に配置され、該真空チャンバ外に配置した複数のアクチュエータの各々から前記テーブルの側面部にXYの各方向に停びたアームがあり、該各アームはXYの交差する他の方向の動きに対してテーブルの側面部においてスライドし得る端部を有し、前記テーブルは前記各アクチュエータの動作によりアームを介してXYおよび日の各方向に水平移動し得るようになっており、

さらに下面または上面に上記基板の他方を脱着言在に固 着させる加圧板が前記真空チャンバ内に配置され、

前記テーブルを前記各アクチュエータにより水平移動させて基板同士の位置決めを行い、次いで前記加圧板をテーブルの方向に移動させ、両基板の対向間隔を狭めて両基板を貼り合せるように構成したことを特徴とする基板組立装置。

【請求項2】上記請求項1において、真空チャンパは上 チャンパと下チャンパとで構成され、その上チャンパに は前記加圧板またはテーブルが内蔵され、下チャンパに は前記テーブルまたは加圧板が内蔵されていることを特 徴とする基板組立装置。

(請求項3)上記請求項2において、上チャンバに内蔵された加圧板またはテーブルは上基板を真空吸着する手段と静電吸着する手段とを備えていることを特徴とする 基板組立装置。

## [発明の詳細な説明]

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、貼り合せるべき基 板同士をそれぞれ上下に保持して対向させ、位置決めを 行うと共に間隔を狭めて貼り合せる基板組立装置に関す るものである。

## [0002]

(従来の技術)液晶表示パネルの製造には、透明電極や 薄膜トランジスタアレイを付けた2枚のガラス基板を数 μm程度の極めて接近した間隔をもって接着剤(以下、 シール剤ともいう)で貼り合わせ(以後、貼り合せ後の 基板をセルと呼ぶ)、それによって形成される空間に液 晶を封止する工程がある。

(0003) この液晶の封止を行うものとして、注入口を設けないようにシール剤をクローズしたパターンに推画した下基板上に液晶を滴下しておいて、真空チャンバ中で上基板をピン上に保持して上基板を上に配置し、上基板を手動で位置決めしてから、ピンを下降させてシール到を介して上下基板を接触させ、真空をリークすることによって接触時との差圧を利用して上下基板を加圧し

貼り合わせを行うものが特開平10-26763号公報で提案されている。 "

#### [0004]

(発明が解決しようとする課題)上記従来技術では、上 基板をピン上に保持して下基板に対する位置合わせを行 うので、上基板の下面に設けられた透明電極や薄膜トラ ンジスタアレイなどがピンで損傷する恐れがある。

【0005】そこで、下基板を位置法め用のXY €テーブル上に配置し、上基板は移動させないようにすることが考えられるが、従来のXY €テーブルはX, Y, Øの各個別テーブルを多設重ねに設け、アクチュエータでそれぞれを駆動し、X, Y, Øの各方向へ移動する構成となっており、このような構成では、XY €テーブルは垂直方向の寸法が大きくなるため、真空チャンバが大型化し、また、ねじ穴やテーブル同士の連結部などの細かな隙間に入り込んだガスが抜けるのに時間がかかるため、真空チャンバ内が目標の真空度に到達するまでの時間が著しく遅くなるという問題がある。

【0006】それゆえ、本発明の目的は、真空チャンバ内において基板を損傷することなく高精度に位置合わせでき、速やかに貼り合せることが可能な基板組立装置を提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発 明の特徴とするところは、貼り合せるべき基板同士をそ れぞれ上下に保持して対向させ、位置法めを行うと共に 間隔を狭めて、いづれかの基板に設けた接着剤により真 空中で両基板を貼り合せる基板組立装置において、上面 または下面に上記基板の何れか一方を脱着自在に回着さ せる単一のテーブルが真空チャンバ内に配置され、該真 空チャンバ外に配置した複数のアクチュエータの各々か ら前記テーブルの側面部にXYの各方向に伸びたアーム があり、該各アームはXYの交差する他の方向の動きに 対してはテーブルの側面部においてスライドし得る端部 を有し、前記テーブルは前記各アクチュエータの動作に よりアームを介してXYおよびもの各方向に水平移動し 得るるようになっており、さらに下面または上面に上記 基板の他方を脱着自在に固着させる加圧板が前記真空チ ャンバ内に配置され、前記テーブルを前記各アクチュエ ータにより水平移動させて基板同士の位置決めを行い、 次いで加圧板をテーブルの方向に移動させ、両基板の対 向間隔を狭めて両茎板を貼り合せるように構成されてい ることにある。

## [8000]

(発明の実施の形態)以下、本発明の一実施形態を図に 基づいて説明する。

(0009)図1万室図4において、本発明になる基板 組立装置は、液晶滴下部S1と基板貼合部S2から構成 され、この両部分は架台2上に隣接して配置される。架 台2の上方には基板貼合部S2を支持するフレーム3が ある。また、栗台2の上面には、Xステージ4が備えられている。Xステージ4は、駆動モータラにより、図面上で左右のX鞋方向に、即ち、液晶滴下部S1と基本できるようになっている。Xステージ4の上には下チャンバ6が固定されている。下チャにはボールベアリング77が敷いてあり、その上にはボールベアリング77が敷いてあり、その上にはボールベアリング77が敷いてあり、その上にはボールベアリング77が敷いてあり、その上にはボールベアリング77が敷いてあり、その上にはボールが取りである。た側面には、すなから伸ばしたアームが取り付けてある。のアチャンバ6の側面に固定された2個のアームが取り付けてあり付けてありた。このアームの側面に固定された2個のアクチュエータ10から伸ばしたアームが取り付けてある。

【0010】図3はそれぞれのアクテュエータ9,10から伸びたアーム9 aまたは10aとテーブル8の丁字 状レール8 aの接続部分(端部)を示している。

【〇〇11】テーブル8は方形であり、X、Y各方面におけるそれぞれ一方の側面部に丁字状レール8ュがあって、各アーム9a、10aの端部にローラ9b、10bがテーブル8とそれぞれの側面部における丁字状レール8aの間に位置するようにとりつけてある。

(0012) 従って、アクチュエータ10は不変で、アクチュエータ9がアーム9ュをX方向に前後させてテーブル8をX方向に移動させようとする場合、アクチュエータ10に接続されたアーム10ュのローラ10bがますることによって、テーブル8とアーム10ュはスライドするだけでアクチュエータ10の拘束を受けず、テーブル8をX方向に移動させることができる。まができる。さらに、アクチュエータ9、10の移動量を同時に適宜量だけ変えた場合、テーブル8を∂方向に回転させることができる。

【0013】よってテーブル8は、Xステージ4とは別に下チャンバ6内で自由にX、Yおよび8の各方向に移動させることができる。

(0014)テーブル8上には下基板1Aを搭載する吸 着部11がある。

【〇〇15】液晶滴下部S1は、テーブルSに保持された下基板1Aに所望量の液晶剤を滴下するためのディスペンサ13,これを上下移動させるためのZ軸ステージ14,それを駆動するモータ15, Z軸ステージ14とともにディスペンサ13をX軸ステージ4と直角に移動させるためのY軸ステージ15とこれを駆動するモータ17とで構成され、フレーム3に固定されている。

【0016】メステージ4を駆動モータラにより×方向に、ディスペンサ13を駆動モータ17によりY方向に移動させることにより、下基板1A上の任意の個所に所望量の液晶剤が満下される。

----(0017)液晶縞下後の下墨板1点を指氧保持したN ステージ4は、基板駐合部S2の下部に駆動モータラによって写動する。

【0018】基板貼合部S2では、上チャンバ21とその内部の加圧板27及び静電吸着板28とがそれぞれ独立して上下動できる構造になっている。即ち、上チャンバ21は、リニアブッシェと真空シールを内蔵したハウジング30を有しており、シャフト29をガイドとしてフレーム3に固定されたシリンダ22により上下のZ軸方向に移動する。

【0019】 Xステージ4が基板貼合部S2に移動していて上チャンバ21が下降すると、下チャンバ6の周りに配置してある0リング44に上チャンバ21のフランジが接触し一体となり、この時真空チャンバ100として機能する状態になる。

(0020)ハウジング30は、上チャンバ21が下チャンバ6と真空テャンバ100を形成して変形しても、シャフト29に対し真空漏れを起こさないで上下動可能な真空シールを内蔵しているので、真空テャンバの変形がシャフト29に固定され静電吸着板28を保持した加圧板27の変形がほぼ防止でき、後述するように静電吸着板28に保持された上基板1Bとテーブル8の吸着部11に保持された下基板1Aとの平行を保って貼り合せが可能となる。

【0021】 23は真空バルブ、 24は配管ホースで、図示していない真空源に接続され、これらは真空チャンバを減圧し真空にする時に使用される。また、 25はガスパージバルブ、 26はガスチューブで、  $N_2$ やクリーンドライエアー等の圧力源に接続され、これらは真空チャンバを大気圧に戻す時に使用される。

【0022】上基板1Bは静電吸着板28の下面に密着保持されるが、大気下においては上基板1Bは真空吸着で静電吸着板28に保持されるようになっている。即ち、41は真空吸着用継手、42は吸引チューブであり、図示していない真空源に接続され、静電吸着板28面には、それにつながる複数の吸引孔が設けられている。

【0023】尚、周りが大気の場合、静電吸着を併用してもよいし、静電吸着力が大きい場合は、真空吸着を不要としてもよい。

【0024】 静電吸着板28はシャフト29で支持された加圧板27に取付けられており、シャフト29はハウジング31に固定されている。ハウジング31はフレーム3に対してリニアガイド34で取付けられ、静電吸着板28は上下動可能な構造になっている。その上下駆動はフレーム3とつながるフレーム35上にブラケット38で固定されたモータ40により行う。駆動の伝達はボールねじ36とナットハウジング37で実行される。【0025】ナットハウジング37は荷重計33を介して、ロシング31とつなが1、その下町の計量収着紙1

8と一体で動作する。

(0026)従って、モータ40によってシャフト29が下降し、上基板1Bを保持した静電吸着板28が下降し、上基板1Bがテーブル8上の下基板1Aと密着して、加圧力を与えることのできる構造となっている。この場合、荷重計33は加圧力センサとして働き、逐次、フィードバックされた信号を基にモータ40を制御することで、上下基板1A、1Bに所望の加圧力を与えることが可能となっている。

【0027】下基板1Aは重力方向の搭数なので、図4に示すようにテーブル8の吸着部11に設けた位置法め 部柄81に押付ローラ82による水平方向での押付けによる位置法のの固定で十分であるが、貼り合わす直の 場小位置法のの際、上基板1Bが下基板1A上のルルクである可能性があることを要する。14との間に入り込んでいる空気が逃げて下基板1A的吸入りがあるので、吸着部11に対してありずれる可能性があるのと、そして、テーブル8に 電吸着の機能を持たせるとといる。そして、テーブル8に 電吸着の機能を持たせるとといる。そして、テーブル8に 電吸着の機能を持たせるとといる。そして、テーブル8に 重吸着の機能を持たせるとといる。そして、テーブル8に 電吸着の機能を持たせるとといる。そして、テーブル8に ものセル取り外しを容易に行なうことができる。

【0028】図4に示す60は、
計電吸着板28が真空吸着をしていて真空チャンバが減圧され真空吸着力が消えて上基板1Bが落下するときに計電吸着板28の傷か下の位置で受け止める受止爪で、上基板1Bの2個の対角の位置にあって下方に伸びたシャフト59で釣り下げた形に支持されている。 具体的には、シャフト59は上チャンバ21のハウジングを介して真空シールされて回転と上下移動が独立してできるようになっている。

【0029】次に、蓋板を吸着する静電吸着板28について説明する。

【0030】 静電吸着板28は絶縁物の板であり、方形の凹部を2個有していて、各凹部に内蔵された平板電極を誘電体で覆ってその誘電体の主面が静電吸着板28の下面と同一平面になっている。埋め込まれた各平板電極はそれぞれ正負の直流電源に適宜なスイッチを介して接続されている。

(0031)従って、各平板電極に正あるいは負の電圧が印加されると、静電吸着板28の下面と同一平面になっている誘電体の主面に負あるいは正の電荷が誘起され、それら電荷によって上基板18の透明電極膜との間に発生するクーロンカで上基板18が静電吸着される。各平板電極に印加する電圧は同極でもよいしそれぞれ異なる双極でもよい。

(0032)次に、本基板組立装置で器板を貼り合わせる工程について説明する。

(0033)先ず、液晶滴下部SIにたいて、モーブル Sの吸着部11に上基板13を保持した治具を搭取し、 駆動モータラでXステージ4を基板貼合部S2に移動させる。そこでモータ40によりシャフト29を介して加圧板27や静電吸着板28を降下させ、上基板1Bを裏空吸着させてからモータ40で上昇させて、上基板1Bを待機状態とする。

【0034】 Xステージ4は液晶滴下部 S1に戻って、空になった治具が外され、テーブル8上に下基板1Aを搭載し、図4に示すように位置法め部材 81と押付ローラ82による水平方向での押付けで、所望位置に固定保持させる。

(0035)図2には示していないが、Y軽ステージ14にはシール剤を吐出するディスペンサがあって、駆動モータ5で下基板1AをX方向に、シール剤ディスペンサをY方向に移動させつつシール剤を吐出させると、下基板1A上にクローズ(閉鎖)したパターンでシール剤を措画できる。

【0036】その後、ディスペンサ13から液晶剤を下 基板1A上に満下する。この場合、シール剤がダムとなって、満下した液晶剤は流失しない。

(0037)次に、Xステージ4を基板貼合部S2に移動させ、シリンダ22で上テャンバ21を降下させ、そのフランジ部を0リング44に当接させて、図1のように下テャンバ10と真空テャンバ100を形成させる。 [0038] そして、真空バルブ23を開放して真空チャンバ100内を減圧していく。

【0039】この減圧はテーブル8が単一構成であるため、従来の多段重ねで複雑な構成になっている細部から 空気が染み出してくるような事はなく、速やかに所望の 真空度に到達する。

【0040】この滅圧時に上基板1Bは静電吸着板28に真空吸着された状態になっているので、滅圧が進んでチャンバ内の真空化が進行していくと上基板1Bが信重していた真空吸着力は消えて行き、上基板1Bが信重で落下する。これを図4に示すように受止爪60で気け止めて、図5に示すように静電吸着板28の億か下の位置に保持しておく。

【0041】真空チャンバ100内が充分真空になった 時点で、静電吸着板28に電圧を印加して受止爪60上 の上基板18を静電吸着板28にクーロン力で吸引保持 する。

【0042】この場合、既に真空になっているので、静電吸着板28と上基板1Bの間に空気が残るようなことは無いし、その空気が逃げるときに上基板1Bが踊ることもない。より重要なことは空気を介在させることなく、静電吸着板28に上基板1Bが密着していることである。そのため、誘起電荷で放電を発生することがない。

【0043】空気を残したまま放電を生じると空気が膨張し、上基板19を静電吸着板28から剥離させたり、 上基板19上のバケールを破壊することがあるが、中馬 施形態によれば空気が存在しないので、そのような異常 事故は発生しない。

【0044】その後、昇降アクチェータでシャフト59を下降させ、次に、回転アクチェータでシャフト59を回転させ、受止爪60が上下両基板1A、18の貼り合わせの邪魔にならぬようにしてから、モータ40で加圧板27を降下させ、荷重計33で加圧力を計測しつつモータ40を制御して上下両基板1A、18を所望間隔に貼り合わせる。

(0045) この場合、上基板1 Bは静電吸着板28に密着していて中央部が垂れ下がっていることはないから、液晶剤中のスペーサに悪影響を与えたり、基板同士の位置合わせが不可能になることはない。また、上下両基板1 A, 1 Bを平行に維持して加圧して貼り合わせるから、シール剤による接合部にリーク個所を形成してしまう恐ればなく、液晶剤を上下両基板1 A, 1 B間に密封できるとともに外気が侵入してボイドを形成し表示機能を阻害することもない。

【0046】上下両基板1A、1Bの位置合わせは、図 ちに示すように、上チャンバ21に設けた覗き窓21aからシャフト29に設けた画像認識カメラ32で上下各基板1A、1Bに設けられている位置合わせマークを読み取って画像処理により位置を計測し、テーブル8をアクチュエータ9、10により微動させて、高精度な位置合わせを行う。この場合、上下両基板1A、1Bは貼り合わせられる対向面が何物にも接触しないで保持されているので、損傷を受けないこの微動位置合わせにおいて、テーブル8は真空チャンバ100内にあり上下チャンバ6、21が移動することはないので、真空チャンバ100内の真空度を維持することができる。

【0047】貼り合わせが終了すると、真空バルブ23を締めてガスパージバルブ25を開き、真空チャンバ1 00内に№やクリーンドライエアーを供給し、大気圧に戻してからガスパージバルブ25を閉じて、シリンダ22で上チャンバ21を上昇させ、Xステージ4を液晶満下部S1に戻して、テーブル8からセルを外し次の貼り合わせに備える。

【0048】ここで、貼合後のセルは帯電している場合があるので、接地した除電バーに接触させたりイオン風を吹き当てるなどの除電処理をしてから、デーブル8からセルを外すと良い。デーブル8から外したセルは下流のUV光照射装置や加熱装置などでシール剤が硬化される。

(0049) 以上の実施形態では、シール剤を吐出して液晶を滴下した後直ちに貼り合せに移行するので、基板が塵埃を受けづらく生産歩音まりを向上できる。また、Xステージ4を上基板1Bの真空チャンバ100内への搬送に利用でき、装置の小型化が図られている。またさらに、Xステージ4を単一のステージとすることで、真空チャン、内の存限を最少とすることででき、これによ

り目的の真空度に速やかに到達することができる。 (0050)本発明は以上説明した実施形態に限らず、 以下の様に実施しても長い。

【0051】(1)上基板1Bの静電吸着板28への供給は、Xステージ4に上下方向に伸縮可能な複数の受止爪(図4の受止爪60相当のもの)を設けておいて、Xステージ4が液晶滴下部S1にあるときにその複数の受止爪上に上基板1Bを載せて、Xステージ4を基板貼合部S2に移動させるようにしてもよい。

(0052)(2)ロボットハンドから直接静電吸着板28に吸引吸着させてもよい。

(0053)(3)上記(1)で説明したXステージ4に設けた受止爪で、減圧が進む際に落下する上基板1Bを受け止めるようにしてもよい。

(0054)(4)図4の受止爪60や上記(1)で説明したXステージ4に設けた受止爪で、上基板1Bが落下する前に上基板1Bを静電吸着板28に押し付けておいて、静電吸着板28に吸引吸着された状態から減圧を進めて、静電吸着に切替えてもよい。この場合、物理的に上基板1Bが静電吸着板28に密着しているということがないようにしておくことで、上基板1Bと静電吸着板28の間の空気を減圧とともに真空化することができる。

【0055】(5)図4の受止爪60や上記(1)で説明したXステージ4に設けた受止爪で、上基板1Bを静電吸着板28から僅かに離れた位置に保持しておいて、真空吸着をしないで減圧を進める途中で静電吸着を行なってもよい。

【0056】(6)図4では受止爪60により上基板1 Bの2個の角部(対角を構成する2隔)を保持している が、上基板1Bの4個の角部(4隔)を保持したり、上 基板1Bの4辺あるいは長手方向の2辺または幅方向の 2辺を適宜な手段で保持するようにしてもよい。

【0057】(7)アーム9a、10aとテーブル8との接続部分は、アーム9a、10aとテーブル8がアーム9a、10aの取り付け方向に対して直角に移動できれば長いので、アーム9a、10aに固定するローラ9b、10bの代りに、回転しなくても、テフロンなどの滑りやすいものを使ってもよい。

(0058) (8) テーブル8は下チャンバ6内で滑らせることができればよいので、テーブル8の下面にテフロン(登録商標)などを貼れば、ボールベアリングはなくてもよい。

(0059)(9)図示の実施形態は、テーブル8を下チャンパ側とし、加圧板27を上チャンパ側とし、加圧板27を上チャンパ側とし、加圧板27を降下させて両蓋板を貼り合せるものについて説明したが、その逆に、テーブル8を上チャンパ側とし、加圧板27を下チャンパ側とし、下基板を上基板に対して持ち上げるようにしてもよい。この場合、画像認識用のカメラはアー・・・組ェー・・・一選のテーブル

8を微動させて位置合わせを行う。

(0060) (10) 液晶表示パネルの製造だけでなく、 その他の基板の貼り合わせに適用できる。

## [0061]

【祭明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 真空チャンバ内において基板を損傷することなく高精度 に位置合わせして、速やかに貼り合せることができる。 (図面の簡単な説明)

【図1】本発明の一臭施形態を示す基板組立装置の概略 図である。

【図2】図1に示した基板組立装置の真空チャンバを開 放し上下各基板を貼り合わせのためにセットするときの 状況を示す図である。

【図3】図1に示した基板組立装置のテーブルとこれを 水平移動させるアームの構成を示す図である。

【図4】真空チャンバ内で上基板を受止爪上に保持した 状況を示す斜視図である。

【図5】真空チャンバ内で上下基板の位置合わせを行う 状況を示す要部断面図である。

## (符号の説明)

52 臺板貼合部

1.4 下基板

18 上基板

下チャンバー

テーブル

T字状レール

9,10 アクチュエータ

9a, 10a 7-4

9b, 10b ローラ

上チャンバ

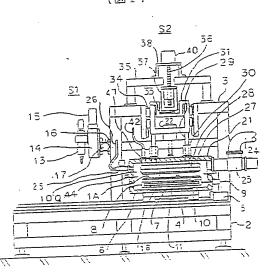
23 真空バルブ

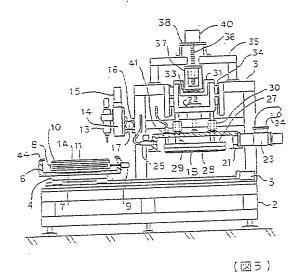
- 27 加圧板

28 靜電吸着板

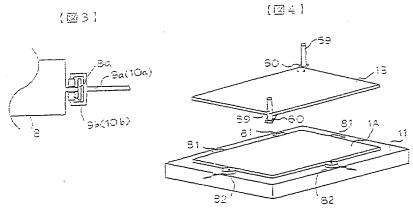
100 真空チャンバ

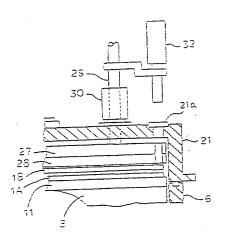
(図1)





(図2]





!(7) 001-282126 (P2001-28t8

プロントページの続き

(72) 発明者 今泉 潔

茨城県電ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72) 発明者 平井 明

茨城県電ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ フノエンジニアリング株式会社開発研究所

內

Fターム(参考) 2HO88 FA01 FA16 FA24 FA30 HA01 MA20

2H090 JB02 JC12

5G435 AA17 BB12 CC09 KK05 KK10